

PAT-NO: JP360062127A
DOCUMENT-
IDENTIFIER: JP 60062127 A
TITLE: DETECTING METHOD OF END POINT OF
ETCHING

PUBN-DATE: April 10, 1985

INVENTOR- INFORMATION:

NAME	COUNTRY
TADA, KEIJI	
FUJII, TAKASHI	
MARUMOTO, MAKOTO	

ASSIGNEE- INFORMATION:

NAME	COUNTRY
HITACHI LTD	N/A

APPL-NO: JP58169139

APPL-DATE: September 16, 1983

INT-CL (IPC): H01L021/302

US-CL-CURRENT: 216/60 , 257/E21.214

ABSTRACT:

PURPOSE: To detect the end point of etching with high accuracy by starting the operation of detection at a point of time when the amount of plasma light is brought to a stationary state, detecting a tendency in which the amount

of plasma light begins to decrease or increase, and detecting the end point of etching.

CONSTITUTION: The operation of detection is started at a point of time when the amount of plasma light is brought to a fixed amount or the amount of a monotonous change after starting a reaction. A tendency in which the amount of plasma light begins to decrease or increase at the same time as the reaction is completed is detected, and the end point of etching is detected. The computation of a secondary differential value is started when the time when the amount of plasma light is brought to the amount of the monotonous change or a fixed amount after starting the reaction passes. A reaching to either decision value in positive and negative decision values regarding the completion of the reaction previously set of the secondary differential value is detected, and a reaching to another decision value of the secondary differential value is detected, thus detecting the end point of etching. According to the method, the end point of etching can be detected with high accuracy even when the curve of the change of a reaction time regarding the amount of plasma light is brought to any curve.

COPYRIGHT: (C)1985,JPO&Japio

⑨ 日本国特許庁 (JP) ⑩ 特許出願公開
⑪ 公開特許公報 (A) 昭60-62127

⑥Int.Cl.⁴ 識別記号 厅内整理番号 ④公開 昭和60年(1985)4月10日
H 01 L 21/302 E-8223-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全 4 頁)

④発明の名称 エッチング終点検出方法

② 特 願 昭58-169139

㉙出願昭58(1983)9月16日

②発明者 多田 啓司 下松市東豊井794番地 株式会社日立製作所笠戸工場内
②発明者 藤井 敬 下松市東豊井794番地 株式会社日立製作所笠戸工場内
②発明者 丸本 愿 下松市東豊井794番地 株式会社日立製作所笠戸工場内
⑦出願人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地
④代理人 井理士 高橋 明夫 外1名

明 細 書

発明の名称 エッチング終点検出方法

特許請求の範囲

- ドライプロセスによるエッティング処理時に特徴的に発生するプラズマ光を選択的に取出し該プラズマ光量の反応時間に対する変化によりエッティング終点を検出する方法において、反応開始後、前記プラズマ光量が一定量若しくは単調な変化量となった時点で検出操作を開始し、プラズマ光量の反応の終了と共に減少若しくは増加し始める傾向を検出した後に、引続いてエッティング終点を検出することを特徴とするエッティング終点検出方法。
- 反応開始後、前記プラズマ光量が一定量若しくは単調な変化量となった時点で、プラズマ光量／反応時間函数の2次微分値の算出を開始し、該2次微分値が前もって設定された反応終了の正負の判定値の内のいずれかの判定値になったことを検出した後に、引続いて該2次微分値が残りの判定値になることを検出する特許請求の

第四圖第1項記載のエンチング終点検出方法。

発明の詳細な説明

(発明の利用分野)

本発明は、エッチング終点検出方法に関するものである。

(発明の背景)

ドライプロセスにてエッティング処理されるウエハのエッティング反応の終点を、エッティング処理時に特徴的に発生するプラズマ光を取り出し、このプラズマ光量の反応時間に対する変化により検出する方法として、例えば、特開昭56-115536号公報に示されているような方法がある。以下、この方法を第1図により説明する。

第1図で、aはエッティング処理時に特徴的に発生するプラズマ光量、例えば、反応生成物に対応したプラズマ光量の反応時間変化曲線である。この場合のプラズマ光量軸は、反応開始と共に急増し短時間経過後に定常状態に達する。その後、このプラズマ光量は反応の終了と共に急減し定常状態になる。このような場合、この方法では、プラ

スマ光量が反応の終了と共に急激した後に定常状態となった時点、つまり、 O_L プラズマ光量／反応時間函数の微分値 ($-d\text{O}_L/dt$) が、前もって設定された反応終了の判定値 I_1 になった時点でエッティング終点が検出される。

このような方法では、プラズマ光量の反応時間変化曲線が上記のような曲線である場合には、エッティング終点を精度良く検出可能であるが、しかし、 O_L プラズマ光量が反応の開始と終了との間で定常状態とならない場合は、反応途中における O_L プラズマ光量／反応時間函数の微分値が判定値になり、その結果、反応途中でエッティング終点が誤って検出されるようになり、従って、エッティング終点を精度良く検出することが不可能になるといった欠点があった。

(発明の目的)

本発明の目的は O_L プラズマ光量の反応時間変化曲線がどのような曲線になろうともエッティング終点を精度良く検出することができるエッティング終点検出方法を提供することにある。

(発明の概要)

本発明は、反応開始後、 O_L プラズマ光量が一定量若しくは単調な変化量となった時点で検出操作を開始し、 O_L プラズマ光量の反応の終了と共に減少若しくは増加し始める傾向を検出した後に、引続いてエッティング終点を検出することを特徴とするもので、 O_L プラズマ光量の反応時間変化曲線がどのような曲線になろうともエッティング終点を精度良く検出できるようにするものである。

(発明の実施例)

本発明の一実施例を第2図～第4図で説明する。

第2図で、a₁は、エッティング処理時に特徴的に発生する O_L プラズマ光量、例えば、反応生成物に対応した O_L プラズマ光量の反応時間変化曲線である。この場合の O_L プラズマ光量は、反応の開始と共に急増し、その後、反応の終り付近まで_{単調な}減少傾向を示し反応の終了と共に急減し定常状態になる。又、第2図で、b₁は O_L プラズマ光量／反応時間函数の2次微分値曲線である。

この場合、エッティング終点の検出操作、つまり、

O_L プラズマ光量／反応時間函数の2次微分値（以下、2次微分値と略）の算出は反応開始後、 O_L プラズマ光量が単調な変化量となる時間₁₁を経過した時点より開始する。2次微分値が、前もって設定された反応終了の判定値の内で、まず、負の判定値 I_1 になったことを検出し、これにより、 O_L プラズマ光量の反応の終了と共に減少し始める傾向を検出する。その後、検出操作を続行し2次微分値が正の判定値 I_2 になったことを検出し、これにより、エッティング終点を検出する。

第3図で、a₂は、エッティング処理時に特徴的に発生する O_L プラズマ光量、例えば、反応生成物に対応した O_L プラズマ光量の反応時間変化曲線である。この場合の O_L プラズマ光量は、反応の開始と共に急増した後急減し、その後定常状態に対し、更に反応の終了と共に急増し定常状態になる。又、第3図で、b₂は、この場の2次微分値曲線である。

この場合、エッティング終点の検出操作、つまり、2次微分値の算出は、反応開始後、 O_L プラズマ光量が一定量となる時間₁₂を経過した時点より開始す

る。この検出操作の過程で2次微分値が、前もって設定された反応終了の判定値の内で、まず、正の判定値 I_1 になったことを検出し、これにより、 O_L プラズマ光量の反応の終了と共に増加し始める傾向を検出する。その後、検出操作を続行し2次微分値が負の判定値 I_2 になったことを検出し、これにより、エッティング終点を検出する。

第4図は、以上のエッティング終点の検出手順を示すもので、反応開始からの時間が時間₁₃を経過した時点で、2次微分値の算出を開始する。ここで、 O_L プラズマ光量の反応の終了と共に減少若しくは増加し始める傾向を検出する段階を1段目検出とし、その後のエッティング終点を検出する段階を2段目検出とする。2次微分値の算出開始後、1段目検出は終了しているか否かをチェックする。1段目検出が終了していないければ、例えば、第2図に示すように O_L プラズマ光量が反応の終了と共に急減し定常状態になる場合は、2次微分値が負の判定値以下か否かをチェックする。2次微分値が負の判定値以下となつた時点で1段目検出が完了

する。又、2次微分値が負の判定値以上の場合は、このようなサイクルを2次微分値が負の判定値以下となるまで繰返す。1段目検出が完了した後は、2段目検出に移行し、2次微分値が正の判定値以上となった時点で2段目検出が完了し、これでエッティング終点の検出が終了する。尚、第3図に示すようにプラズマ光量が反応の終了と共に急増し、定常状態になる場合は、判定値の符号を入れ替えることで同様に対処できる。

本実施例のようなエッティング終点検出方法では、反応開始後、プラズマ光量が単調な変化量、一定量となる時間を経過した時点で、2次微分値の算出を開始し、この2次微分値が前もって設定された反応終了の正負の判定値の内のどちらかの判定値になったことを検出した後に、この2次微分値が更に残りの判定値になったことを検出することで、エッティング終点を検出できるため、² プラズマ光量反応の開始と終了との間で定常状態とならない場合でも、エッティング終点を精度良く検出できる。

四、本実施例の他に、プラズマ光量の反応時間変化曲線が次のような曲線であっても特に問題はない。

- (1) 反応の開始と共に急増し短時間経過後に定常状態に対し、その後、反応の終了と共に急減し定常状態となるプラズマ光量の反応時間変化曲線。
- (2) 反応の終了と共に漸減し定常状態となるプラズマ光量の反応時間変化曲線。
- (3) 反応の終了と共に漸増し定常状態となるプラズマ光量の反応時間変化曲線。

(発明の効果)

本発明は、以上説明したように反応開始後、プラズマ光量が一定量若しくは単調な変化量となる時間を経過した時点で検出操作を開始し、該検出操作によりプラズマ光量の反応の終了と共に減少若しくは増加し始める傾向を検出した後に、引続いてエッチング終点を検出した後に、引続いてエッチング終点を検出することで、プラズマ光量の反応時間変化曲線がどのような曲線になろうとも

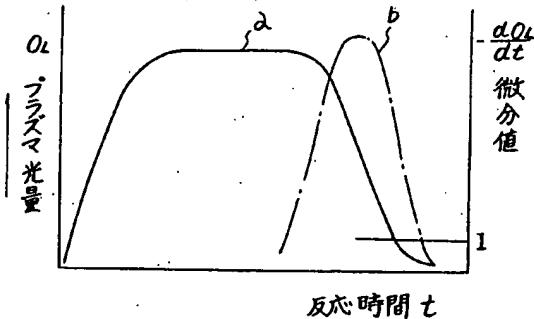
エッティング終点を精度良く検出できるという効果がある。

図面の簡単な説明

第1図は、従来のエッティング終点検出方法を説明するプラズマ光量、プラズマ光量／反応時間因数の微分値と反応時間との関係線図、第2図～第4図は、本発明の一実施例を説明するもので、第2図、第3図は、プラズマ光量、2次微分値と反応時間との関係線図、第4図はエッティング終点検出手順のフローチャートである。

a_1, a_2 …… プラズマ光量の反応時間変化曲線、
 b_1, b_2 …… 2次微分値曲線、 I_1 …… 負の判定値、
 I_2 …… 正の判定値

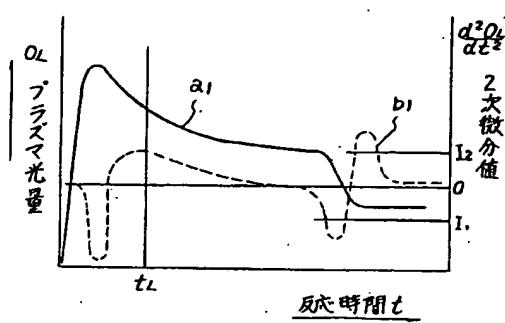
第一回



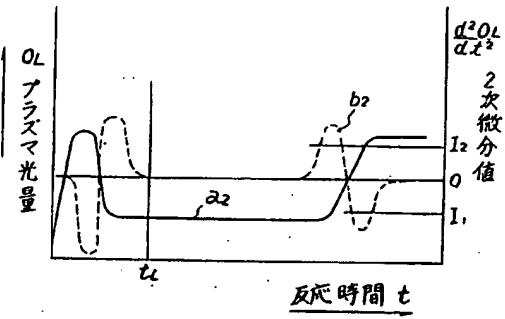
作者人：垂理士
译者人：李 桥 明
校对人：王 勇

代理人 井理士 品相 明 天

オ2図



オ3図



オ4図

